

공개특허실용신안공보 2000-13호(발행일 2000.4.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0022032	C08J 5/18	크라이오백 인코포레이티드	비닐리덴 클로라이드 공중합체 함유 블렌드로부터 제조된 필름
특2000-0022062	B01J 37/34	지펜스 악티엔게젤샤프트	촉매 변환기의 제조 방법 및 그에 따라 제조된 촉매 변환기
특2000-0022077	C08F 8/50	시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 인코포레이티드	NOR-HALS-화합물에 의한 중합체 분해
특2000-0022090	C08F 10/00	더블유. 알. 그레이스 앤드 컴파니-콘	파열가능한 분무 건조된 응집된 지지체, 이러한 지지체의 제조방법 및 이에 지지된 올레핀 중합 촉매
특2000-0022119	B01J 31/16	셀라네제 쉐미칼스 오이로페 게엠베하	촉매 및 상기 촉매의 존재하에서의 알데히드의 제조 방법
특2000-0022137	B01J 20/18	김벌리-클라크 월드와이드, 인크	분자체 분말의 분배 방법
특2000-0022155	B01J 29/40	달리안 인스티튜트 오브 케이컬 피직스, 차이니즈 아카데미 오브 사이언시즈	알킬화반응 촉매 및 이의 용도
특2000-0022298	B01J 27/06	아르코 케미컬 테크날러쥐. 엘.피	작용성화 중합체를 함유하는 이중 금속 시안화물 촉매
특2000-0022369	B01J 23/72	바스프 악티엔게젤샤프트	시클로헥산올의 탈수소화 촉매, 그의 제조 방법 및 용도
특2000-0022420	C08F 12/00	셀 인터나쵸나아레 레사아치 마아즈샤프 비이부이	중합체 입자의 제조방법

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0021255	C08L 23/06	엘지전선 주식회사	전도성 고분자 조성물과 이것을 이용한 전기장치
특2000-0021338	C08G 64/24	주식회사 삼양사	고유동성 폴리카보네이트 수지
특2000-0021803	C08L 75/14	에스케이씨 주식회사	자외선 경화형 조성물 및 이를 이용한 내스크래치 필름
특2000-0022070	C08L 95/00	엘프 앙타르 프랑스	중합체/비투먼 조성물의 제조방법 및 외장재에의 응용
특2000-0022089	C08L 69/00	가와사키 케미칼 홀딩 캄파니, 인코포레이티드	폴리카보네이트/폴리올레핀계 수지조성물과 그 제조방법 및 성형체
특2000-0022144	C07D 251/34	다이깁 고오교 가부시키가이샤	불소 함유 트리알릴이소시아누레이트, 이를 함유한 가황용 엘라스토머 조성물 및 가황 방법
특2000-0022268	C08G 18/76	임페리알 케미칼 인더스트리즈 피엘씨	미공질의 엘라스토머성 폴리우레탄 발포체
특2000-0022316	C08G 69/14	더블유. 알. 그레이스 앤드 캄파니-콘	액체로부터 폴리페놀의 제거를 위한 폴리아미드조성물
특2000-0022418	C08L 53/02	셀 인터나쵸나아레 레사아치 마아츠샤피 비이부이	고 1,2-함량 열가소성 엘라스토머 오일 폴리올레핀 조성물
특2000-0022419	C08L 53/02	셀 인터나쵸나아레 레사아치 마아츠샤피 비이부이	낮은 아렌 함량의 열가소성 엘라스토머/오일/폴리올레핀 조성물

## 2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0006642	C02F 1/38	주식회사 경일기술공사	오,폐수 및 냉각수 원심분리장치
실2000-0006838	C02F 1/42	포항종합제철 주식회사	이온교환탑의 불순물 배출용 스트레이너
실2000-0006854	C02F 1/48	윤치원	자화수 제조장치
실2000-0006866	C02F 1/00	현대중공업 주식회사	회분식 폐수처리 장치에서 효율적인 처리수 배출 장치
실2000-0006880	C02F 1/58	삼성상용차 주식회사	이온제거기능이 부가된 폐수 재생장치
특2000-0021218	C02F 3/10	한상배	질소· 인제거를 위한 유동상 생물막담체 및 하폐수처리방법
특2000-0021257	B01D 53/34	삼성전자 주식회사	가스를 정화하기 위한 반도체 장치 및 이 장치의 정화능력을 감지하는 방법
특2000-0021271	C02F 3/30	삼성전자 주식회사	호기성 및 혐기성 처리에 의한 폐수 처리 방법
특2000-0021400	C02F 3/34	김영수	진흙미생물을 이용한 오,폐수처리방법 및 장치
특2000-0021789	B01D 11/00	삼성에스디아이 주식회사	전지 제조용 가소제 추출 장치
특2000-0021897	C02F 1/78	주식회사 대우	오존분해속도 측정장치 및 그를 이용한 수처리 시스템
특2000-0022026	B01D 53/14	캐나다인 케미칼 리클레이밍 엘티디	가공 액체의 회수 방법
특2000-0022135	C02F 3/22	쥘비. 오도베츠 에스.알.엘	오염된 폐수 정화용 반응장치
특2000-0022411	B01D 3/08	린데 악티엔게젤샤프트	물질 교환 칼럼용의 유체 분배기

### 3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0021199	C09J 11/00	김종길	당구대피복천 보수용 접착제
특2000-0021261	C09B 29/01	삼성에스디아이 주식회사	아조 염료 및 이를 포함하는 액정조성물
특2000-0021744	C09B 61/00	한국섬유기술연구소	도토리, 밤 껍질로부터의 천연염료 제조방법 및 이 염료를이용하는 섬유제품 염색방법
특2000-0022104	C09D 11/02	가부시킴가이샤 큐빅	액압전사용 잉크, 액압전사용 필름, 액압전사품 및 액압전사방법
특2000-0022116	C09K 11/06	짓쏘 가부시킴가이샤	적색 발광재 및 이를 이용한 유기전계 발광소자
특2000-0022117	C08F 10/00	미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 컴파니	폴리올레핀 미소구
특2000-0022128	C09K 3/00	가부시킴가이샤 시세이도	겔화제 및 겔조성물
특2000-0022257	C09K 3/00	닛폰 세키유 주식회사	자외선 흡수 물질 및 자외선 흡수관
특2000-0022407	C09K 19/38	메르크 파텐트 게엠베하	액정 디스플레이 장치
특2000-0022422	G03F 7/008	도요 고세이 고교 가부시킴가이샤	감광성 조성물 및 패턴형성방법
특2000-0022497	C07D 493/04	메르크 파텐트 게엠베하	키랄성 도펀트
특2000-0022498	C10L 1/08	엑손 리써치 앤드 엔지니어링 컴파니	감소된 미립물질을 방출하는 합성 디젤 연료